

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成24年4月12日(2012.4.12)

【公開番号】特開2009-256784(P2009-256784A)

【公開日】平成21年11月5日(2009.11.5)

【年通号数】公開・登録公報2009-044

【出願番号】特願2009-60645(P2009-60645)

【国際特許分類】

C 23 C 14/04 (2006.01)

H 05 B 33/10 (2006.01)

H 01 L 51/50 (2006.01)

【F I】

C 23 C 14/04 C

H 05 B 33/10

H 05 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月25日(2012.2.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一方の面に、金属窒化物を含む第1の光吸收層と、前記第1の光吸收層に接して形成された材料層とを有し、他方の面に、金属窒化物を含む第2の光吸收層を有する第1の基板を用い、

前記第1の基板の前記材料層が形成された前記一方の面と、第2の基板の被成膜面とを対向させ、

前記第1の基板の前記第2の光吸收層を有する前記他方の面側から周波数10MHz以上、パルス幅100fs以上10ns以下のレーザ光を照射し、前記第1の光吸收層と重なる位置にある前記材料層を加熱し、前記材料層の一部を前記第2の基板の被成膜面に成膜することを特徴とする成膜方法。

【請求項2】

請求項1において、

前記金属窒化物は、窒化チタン、窒化タンタル、窒化モリブデン、窒化タングステン、窒化クロムのいずれかであることを特徴とする成膜方法。

【請求項3】

請求項1または請求項2において、

前記第1の光吸收層及び前記第2の光吸收層における窒素原子の含有量は、金属原子を1とすると、0.1以上1.3以下の割合であることを特徴とする成膜方法。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか一において、

前記第1の光吸收層が島状に形成されていることを特徴とする成膜方法。

【請求項5】

請求項1乃至請求項4のいずれか一において、

前記第1の光吸收層がストライプ状に形成されていることを特徴とする成膜方法。

【請求項6】

請求項 1 乃至 請求項 5 のいずれか一に記載の成膜方法を用い、
前記材料層の一部を、前記第 2 の基板の被成膜面上に形成されている第 1 の電極上に成膜
することを特徴とする発光装置の作製方法。